

上海伯东代理美国原装进口 KRI 霍尔离子源 eH 3000

产品名称	上海伯东代理美国原装进口 KRI 霍尔离子源 eH 3000
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:eH 3000
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

上海伯东代理美国原装进口 KRI [霍尔离子源](#) eH 3000 适合大型真空系统, 与友厂大功率离子源对比, eH 3000 是目前市场上高效, 提供更高离子束流的离子源.

尺寸: 直径= 9.7 “ 高= 6 ” 放电电压 / 电流: 50-300V / 20A操作气体: Ar, Xe, Kr, O2, N2, 有机前体KRI 霍尔 [离子源](#) eH 3000 特性 水冷 - 加速冷却 可拆卸阳极组件 - 易于维护; 维护时,*大限度地减少停机时间; 即插即用备用阳极 宽波束高放电电流 - 高电流密度; 均匀的蚀刻率; 刻蚀效率高; 高离子辅助镀膜 IAD 效率 多用途 - 适用于 Load lock / 超高真空系统; 安装方便 等离子转换和稳定的功率控制KRI 霍尔 [离子源](#) eH 3000 技术参数

型号	eH3000 / eH3000L / eH3000M / eH3000LE
供电	DC magnetic confinement
- 电压	50-250V VDC
- 离子源直径	~ 7 cm
- 阳极结构	模块化
电源控制	eHx-25020A
配置	-
- 阴极中和器	Filament, Sidewinder Filament or Hollow Cathode
- 离子束发散角度	> 45 ° (hwhm)
- 阳极	标准或 Grooved
- 水冷	前板水冷
- 底座	移动或快接法兰
- 高度	4.0'
- 直径	5.7'
- 加工材料	金属电介质半导体
- 工艺气体	Ar, Xe, Kr, O2, N2, Organic Precursors
- 安装距离	16-45 ”
- 自动控制	控制4种气体

* 可选: 可调角度的支架;KRI 霍尔 [离子源](#) eH 3000 应用领域溅镀和蒸发镀膜 PC辅助镀膜 (光学镀膜) IBAD表面改性, 激活 SM直接沉积 DD1978年 Dr. Kaufman 博士在美国创立 Kaufman & Robinson, Inc 公司, 研发生产[考夫曼离子源](#), [霍尔离子源](#)和[射频离子源](#). 美国[考夫曼离子源](#)历经 40 年改良及发展已取得多项专利. 离子源广泛用于离子清洗 PC, 离子蚀刻 IBE, 辅助镀膜 IBAD, 离子溅射镀膜 IBSD 领域, 上海伯东是美国[考夫曼离子源](#)中国总代理.

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗女士